®日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-266393

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月27日

H 05 B 33/22 H 01 L 33/00

8815-3K Α 8934-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3頁)

60発明の名称 複合発光体薄膜及び薄膜EL素子

> ②特 願 平2-63152

22出 願 平2(1990)3月14日

@発 明 者 岡嶋 道生

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

@発明者

任 田

隆夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

勿出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

外1名 個代 理 人 弁理士 粟野 重孝

1. 発明の名称

複合発光体薄膜及び薄膜EL素子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 厚さが50 n m 以下 1 n m 以上の 硫 化亜鉛もしくは少なくとも硫化亜鉛と他のIIbVI族 化合物半導体との混晶を主成分とする蛍光体層を 該蛍光体層のエネルギーギャップより大きなエネ ルギーギャップの 少なくとも硫化マグネシウム と他のアルカリ土類金属の硫化物との混晶を主成 分とする障壁層で挟持した構成単位を、 一単位も しくは複数単位繰り返して設けたことを特徴とす る複合発光体薄膜
- (2)請求項1に記載の複合発光体薄膜と 前 記複合発光体薄膜の外側から電圧を印加する手段 とを備えたことを特徴とする薄膜EL業子。
- (3) 複合発光体薄膜の少なくとも一方の面に 誘電体薄膜が形成され 更にその外側から電圧を 印加する手段が配設されていることを特徴とする 請求項2に記載の薄膜EL素子。

- (4) 蛍光体層と障壁層の格子定数の違いが 5 %以内であることを特徴とする請求項1に記載の 復合発光体薄膜
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本願発明は 発光効率が高く、青色もしくは紫 外の波長域で明るく発光する発光体薄膜及びそれ を用いたEし案子に関するものである

従来の技術

近年 コンピューター端末などに用いるフラッ トディスプレイとして、 薄膜EL素子が盛んに研 究されている。 黄橙色発光のマンガン添加硫化亜 鉛からなる蛍光体薄膜を用いたモノクロ薄膜EL ディスプレイは既に実用化されている ディスプ レイとして広汎な用途に対応するためにはフルカ ラー化が不可欠であり、赤色 緑色 青色の3原 色に発光するEL用蛍光体の開発に多大な力が注 がれている この中で青色発光蛍光体としては 2nS: Tmや SrS: Ce、赤色蛍光体とし ては ZnS: Sm. CaS: Eu、 緑色蛍光体 としては2nS: Tb, CaS: Ceなどが盛んに研究されている。

一方 発光ダイオードにおいても 同様にフルカラー化をめざして 短波長化の研究が盛んに行われている SiC GaN ZnS ZnS e 紙 広いパンドギャップの半導体材料を用いたPN接合 MIS接合の形成により、青色LEDの高輝度化が試みられている。

発明が解決しようとする課題

上記の電界発光用蛍光体薄膜は 赤色及び緑色に関しては発光輝度 効率に問題があり 青色に関しては色純度に問題があり、現在 実用的なレベルのカラーELパネルは形成されていない。

一方 LEDに関しては 赤色については十分 高輝度の発光素子が得られ実用化されているが 緑色 青色については 実用化レベルとしては不 十分である。

さらに より短波長の紫外に発光波長域を有する固体発光素子はいまだ実現するに至っていない。 本発明は 発光輝度 効率の高い 青色もしく は紫外発光素子を実現することを目的とする。 課題を解決するための手段

厚さが50nm以下、1nm以上の、硫化亜鉛もしくは少なくとも硫化亜鉛と他のIIbVI族化合物半導体との混晶を主成分とする蛍光体層を、 該蛍光体層のエネルギーギャップより大きなエネルギーギャップの、少なくとも硫化マグネシウムと他のアルカリ土類金属の硫化物との混晶を主成分とする障壁層で挟持した構成単位を、一単位もしくは複数単位級り返して設けた複合発光体薄膜を形成する。

作用

上記構成の複合発光体薄膜を形成することによって、 蛍光体層に青から紫外の波長域で発光した る広いパンドギャップを持った材料を用いて材料を用いた材料を開たける 高電界により発生もしく は注入された電子、 正孔が十分前記蛍光体層に閉じ込められ、 それらが直接もしくは再結合中心を介して効率よく再結合し、 その結果 発光輝度

効率の高い 青色もしくは紫外発光素子が実現で きたと考えられる。

実施例

i.

第1図に本発明の薄膜EL素子の一実施例とし て、その素子構造を示す。 低抵抗Siの基板1上 に分子ピームエピタキシャル 蒸着法により厚さ 1 50 nmのCaF ≠薄膜からなる絶縁層 2 をエピタ キシャル成長させた その上に CaS、MgS を入れたKセルを用いて、厚さ50nmのCa... Mg a. 4 S から成る障壁層 3 を同じくエピタキシャ ル成長させた。 更にその上に 厚さ20ヵmの2 nSからなる蛍光体層 4 をエピタキシャル成長さ せた。 同様にして、 その上に、 Cas.oMgs.4S から成る障壁層と2nSからなる蛍光体層を交互 に順次エピタキシャル成長させ、 合計10周期 層厚700nmの複合発光体層5を完成した。 そ の上に 酸素を10%含むアルゴン雰囲気中で 室温で、BaTa≥O•よりなる 厚さ200nm の絶縁層6を形成した。 最後に厚さ200mmの ITOからなる透明電極7を電子ビーム蒸着法に

より形成し 薄膜EL素子を完成した

本実施例では Si基板」と複合発光体層5の間と、複合発光体層5と透明電極7の間にそれぞれ絶縁層2と絶縁層6を形成したが これらはいずれか一方だけであってもよい。

本発明のE L 果子は パルス幅 3 0 µ s e c、 1 k H z、 1 5 0 V の交流電圧を基板 1 と透明電極 7 との間に印加することによって、 波長 3 5 0 n m ~ 3 8 0 n m の強い紫外発光を得た。

本発明の要点は 紫外域にも及ぶ短波長発光が可能な広いバンドギャップの半導体材料である ZnS、もしくは ZnSと他の IIb VI族化合物半導体との混晶を主成分とする半導体材料を蛍光体層に用いることができた点にある。 なぜ、本発明において初めてそれが可能となったかを以下に述べる。

それは 第1の実施例に代表される薄膜EL素子の構成において 高効率の短波長発光素子を実現するために 障壁層材料として 以下の2つの条件を満たす 硫化マグネシウムと他のアルカリ

土類金属の硫化物との混晶を主成分とする材料を採用したことによる。まず第1に、これらのアルカリ土類金属の硫化物のバンドギャップはいずれむ。 MgSの5.4 e Vを筆頭に3.8~5.4 e V と、 蛍光体層として採用した ZnSの3.5 e V と比べて十分広いため、キャリヤを効率よく蛍光体層に関じ込めることができた。

本発明により、 青色から紫外の短波長で発光する複合発光体薄膜を得ることができた。 また、この複合発光体薄膜を用いて薄膜 E L 素子を形成した場合も、 高効率、 高輝度の短波長薄膜 E L 素子を実現することができた。 本発明を、 青色発光素子、 紫外発光素子、 もしくはフルカラーE L 素子等に応用する際、 特に実用的価値が大きい。

4、 図面の簡単な説明

第1図は 本発明の薄膜 E L 素子の一実施例の 集子の断面図である。

1 ····基板 2、 8 ····- 稳 禄 属 3 ···· 降 壁 展 4 ···· 蛍 光 体 屬 5 ····· 複 合 発 光 体 周 7 ···· 透 明 電 極

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

8 S と C a S の混晶を用いた。 S i 基板と格子整合させた場合の障壁層のバンドギャップは、約4.8 e V と十分広く、 電子、 正孔とも十分蛍光体層に閉じ込められ、 高効率の紫外発光を得ることができたと考えられる。

第1の実施例では基板材料としてSiを採用したが、例えば格子定数の近い GaPを用いても同様の効果が得られた。また、同じく障壁層の材料として CaSとMgSの混晶を用いたが、その代わりに、MgSとBaSとの混晶を用いても、格子整合する組成比の膜であれば同様の効果を有する。

同様に 蛍光体層の材料を 所定の組成比の 2 n S と他の I I b V I 族化合物半導体との混晶を主成分とする半導体材料にする場合も 障壁層材料に上記のアルカリ土類金属硫化物の格子整合した混晶を用いることで第1の実施例同様 蛍光体層のパンドギャップに応じた所望の波長の高効率の短波長薄膜 E L 素子を得ることができた

発明の効果

